

2024年12月30日

研究員:吳健鉦 A51755@capital.com.tw

前日收盤價 目標價

666.0

3 個月 12 個月

近期報告日期、評等及前日股價

公司基本資訊 上櫃後股本(百萬元) 市值(億元) 目前每股淨值(元) 外資持股比(%) 投信持股比(%) 董監持股比(%) 融資餘額(張) 現金股息配發率(%)

產品組合

股價相對大盤走勢

新應材(4749 TT)

受惠於先進製程推進和供應鏈在地化趨勢,成長潛力巨大。

投資建議:基於(1)新應材在先進微影製程材料的產業地位,並 且受惠於半導體大廠 2 奈米量產,預期 2026 年大幅成長,(2)台 灣特用化學類股中,半導體占比最高,具備想像空間。(3)預估 2025年 EPS 11.26元, 2026年成長加速創高。

12/27/2024~12/31/2024 為新應材初次上市競拍期間,公開競拍底 價為 410.26 元,承銷價格為 480.00 元。參考台灣營運內容相近 同業的評價並考量新應材的獲利穩定度,建議競拍價格區間為 33.56 450~510 元。(2025 年 PER40~45X)

1Q~3Q24 累季 EPS5.68 元,已超過 2023 年 EPS3.91 元水準:

10~3024 累計營收為 24.07 億元, 已超過 2023 全年營收, 毛利 率 也從 2023 年的 29.4%提升至 37.7%。稅後淨利方面,2019 年 僅為2百萬元,至2022年已達4.04億元,2023年為3.18億元, 1O~3O24 累計達 5.25 億元。高速成長主要動能受惠於半導體特 化材料的強勁需求,累季 EPS5.68 元。

2025-2026 年將隨 2nm 產能開出大幅成長:

3 奈米製程持續增加: 新應材在 3 奈米製程中已有多項產品導 入量產,預計 2025 年將持續受惠於 3 奈米製程的需求增加。

2 奈米製程開始量產:預計 2 奈米將於 2H25 開始量產,新應材 的洗邊劑 (EBR) 和底部抗反射層 (BARC)已打入 2 奈米供應 鏈。

現有產品使用量提升: 隨著先進製程微影工序越趨複雜,對於 新應材的表面改質劑 (Rinse)等產品使用量將持續增加。

高雄廠二期完工: 高雄廠二期預計於 2024 年底完工,並於 2025 年送半導體大廠驗證,預計可於 2026 年初正式量產。KrF 光阻 材料預計最快於2026年底開始出貨給晶圓廠。

(百萬元)	2024F	2025F	2026F	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F
營業收入淨額	3338	4153	5799	589	692	858	857	931	971	980	1127
營業毛利淨額	1202	1518	2256	185	207	326	323	345	349	353	428
營業利益	560	856	1562	43	88	192	166	113	186	189	261
稅後純益	743	1039	1745	82	173	196	156	218	369	372	444
稅後 EPS(元)	8.05	11.26	18.91	0.89	1.87	2.12	1.69	2.37	4.00	4.03	4.82
毛利率(%)	36.0%	36.5%	38.9%	31.4%	30.0%	38.0%	37.7%	37.1%	36.0%	36.0%	38.0%
營業利益率(%)	16.8%	20.6%	26.9%	7.2%	12.8%	22.4%	19.4%	12.1%	19.1%	19.3%	23.2%
稅後純益率(%)	743	1039	1745	82	173	196	156	218	369	372	444
營業收入 YoY/QoQ(%)	41%	24.44%	35.00%	-66.81%	-70.73%	23.97%	-0.12%	8.65%	4.27%	1.00%	15.00%
稅後純益 YoY/QoQ(%)	133.31%	39.94%	55.59%	-65.12%	-45.65%	13.11%	-20.43%	40.23%	68.89%	0.95%	19.40%

註:稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主;稅後 EPS 以上櫃後股本 9.23 億元計算。





2024年12月30日

ESG:

新應材成立「新應材獎學金」培育材料專才、成立「新住民子女獎助學金」栽培多元人才、積參與「產學合作」,為半導體產業發展恪盡責任。多元共融方面 2024/6 4 個國籍外籍員工在台任職。性別平權方面,女性員工平均占比 >35%,經理級以上之女性主管比例>30%,研發部門的女性主管>50%。

公司簡介:

新應材(4749 TT)成立於 2003 年,原先以顯示器光阻材料起家,近年成功轉型為半導體特用化學材料供應商,並在先進微影製程材料領域取得卓越成就。公司不僅是台灣唯一「黃光微影製程材料」領導廠商,更積極朝向成為本土第一家半導體晶圓光阻供應商的目標邁進。

初期專注於顯示器光阻材料,是台灣顯示器正型光阻的領導廠商。2014 年開始將 CIS 影像感測器光阻導入半導體光學元件客戶,開啟轉型之路。2019 年「表面改質劑」成功打入半導體大廠供應鏈,成為重要的轉捩點。2020 年開始量產半導體先進封裝用光阻與先進黃光微影製程週邊材料。2022 年獲得半導體大廠「黃光材料開發合作與量產支援」優良卓越供應商獎項。

截至 3Q24,半導體特化材料 78.5%、顯示器特化材料 21.5%。

半導體先進微影製程所需材料,主要產品包括清洗劑、洗邊劑、抗反射劑(BARC)、顯影劑和表面改質劑(Rinse)等。其中,表面改質劑是新應材最早打入半導體大廠的產品,也是目前營收佔比最高的產品。

顯示器特化材料,包括 LCD 光阻及 Micro LED 量子點材料。

1Q~3Q24 累季 EPS5.68 元,已超過 2023 年 EPS3.91 元水準:s

新應材自 2019 年開始穩定供貨半導體大廠後,營收逐年成長,2019 年營收為 9.02 億元,至 2023 年達 23.64 億元。半導體特化材料營收占比自 2019年的 5.5%大幅提升至 2023年的 69%。2023年毛利率受到產能利用率略為下滑影響,但 1H24年、3Q24 營收和獲利都顯著成長。

1Q~3Q24 累計營收為 24.07 億元,已超過 2023 全年營收,毛利率也從 2023 年的 29.4%提升至 37.7%。稅後淨利方面, 2019 年僅為 2 百萬元,至 2022 年已達 4.04 億元, 2023 年為 3.18 億元, 1Q~3Q24 累計達 5.25 億元。高速成長主要動能受惠於半導體特化材料的強勁需求,累季 EPS5.68 元。

2025-2026 年將隨 2nm 產能開出大幅成長:

成長動能包括下列因素:

3 奈米製程持續增加: 新應材在 3 奈米製程中已有多項產品導入量產,預計 2025 年將持續受惠於 3 奈米製程的需求增加。

2 奈米製程開始量產: 預計 2 奈米將於 2H25 開始量產,新應材的洗邊劑 (EBR) 和底部抗反射層 (BARC)已打入 2 奈米供應鏈,將成為下一階段營收成長的重要動能。



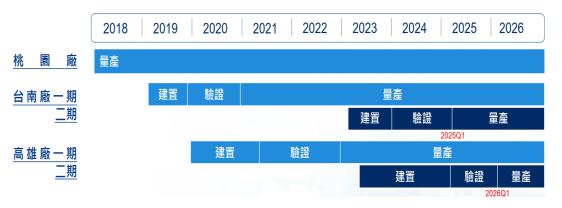


2024年12月30日

現有產品使用量提升: 隨著先進製程微影工序越趨複雜,對於新應材的表面改質劑 (Rinse)等產品使用量將持續增加。

高雄廠二期完工: 高雄廠二期預計於 2024 年底完工,並於 2025 年送半導體大廠驗證,預計可於 2026 年初正式量產。

KrF 光阻開始出貨: 新應材積極開發的 KRF 光阻預計最快於 2026 年底開始出貨給晶圓廠。



二期將具備合成產線,實現從原料合成、純化、到配方的一條龍生產,預期將使毛利率明顯提升。

微影製程週邊材料的關鍵技術:



新應材的核心競爭力在於其微影製程週邊材料,雖然不是半導體製程中的主角(如光阻),但卻是提升良率的關鍵。包括表面改質劑(Rinse)、洗邊劑(EBR)、底部抗反射層(BARC)和清洗劑(Cleaner)等。

表面改質劑 (Rinse): 新應材最早打入半導體大廠供應鏈的產品,主要用於晶圓顯影後的處理,防止光阻圖形在乾燥過程中塌陷。能有效降低晶圓缺陷,提高圖形解析度。新應材的 Rinse 材料效能優於國外大廠,並且在半導體大廠各製程節點皆有廣泛應用。

洗邊劑 (EBR): 用於移除晶圓邊緣多餘的光阻,避免影響後續製程良率。

3



2024年12月30日

新應材的 EBR 是針對半導體大廠 2 奈米製程客製化開發客製化配方是技術關鍵。

底部抗反射層 (BARC): 位於晶圓基板和光阻之間,可吸收反射光,避免光阻圖形變形。

清洗劑 (Cleaner): 用於清潔半導體製程設備,確保製程穩定性。

新應材不單是生產材料,更重要的是其 客製化配方能力。根據半導體大廠不同製程節點的需求,快速調整產品配方,客製化服務包括表面活性劑負載量和結構、融合控制與功能性、以及後續抗蝕劑的化學性質等要素的調配。

不只專注於配方,向上游整合掌握關鍵原料,確保產品品質和供應穩定性。 自行合成原料。透過快速回應與高學習曲線在競爭中脫穎而出。以表面改 質劑為例,新應材在開發階段就送樣超過 200 次。

自 2018 年轉型以來,新應材累計投入超過 11 億元的研發費用,研發團隊 也在持續擴張,目前已超過 110 人投入半導體材料開發

KrF 光阻材料已在認證階段,2026年開始貢獻營收:

4

在半導體微影製程中,隨著技術的不斷進步,對於光阻材料的要求也越來 越高。不同曝光光源的光阻材料應用於不同的晶片製造上。

KrF 光阻材料主要應用於 記憶體晶片、顯示驅動晶片、電源管理晶片等。根據 TECHCET 的預估,KRF 光阻在 2021 年至 2025 年間的複合年成長率為 8%。

新應材的 KrF 材料目標是 在 2026 年底開始少量出貨 KRF 光阻給晶圓廠,並成為本土第一家半導體晶圓光阻材料供應商。

DOWC 新應材產											股票 4	749	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
先進半導體製程 Advance Semiconductor			3nm		2	2nm 1.4nm				1.0nm			
先進封裝製程 Advance Package				2.5D				2D/3D				3D	
光學元件 Optical Device				Ser	sitivity	>100%		,	Se	ensitivity	/ >110%		
顯示器 Display					Mic	ro LED	QD CO			Micro	LED QI	EL	
	光阻	I line DUV KrF DUV ArF											
半導體微影製程		底部抗反射層 BARC											
	週邊材料		洗邊劑 EBR										
			顯影劑 Developer										
		清洗劑 Cleaner											
		表面改質劑 Rinse											
先進封裝製程	光阻	I line FT:60um											
	光阻	DUV KrF R.s 0.3um DUV ArF R.s 0.2um DUV ArF R.s 0.1um											
半導體光學元件	NEAT LINE	Tr. 85	Tr. 85% > Tr. 90% > Tr. 95%										
	週邊材料	High n material ,n= 1.8 \(\rightarrow n=1.9 \) \(\rightarrow n=2.0 \)											
	蝕刻材料	剝膜劑 Stripper											
量子點	油墨/光阻	量子點油墨/光阻 QD ink / QD PR											



2024年12月30日

競爭態勢:

全球光阻市場長期由少數國際大廠寡占,前五大廠包括 JSR、TOK、DOW(DuPont)、Shin-Etsu、Sumitomo 等合計市佔就達 85%。其中,DOW 是美商,其餘皆為日商。

新應材如能成功切入 KRF 光阻市場,將有機會打破外商的壟斷局面,並提升其在半導體材料供應鏈中的地位。目前先以微影製程周邊材料打入市場,再開發關鍵光阻材料。由於光阻是整體製程中極為關鍵的材料,過去僅有國外少數化工大廠能供應,因此新應材若成功,將對公司產業地位產生巨大肯定。

ArF 光阻主要應用於 DRAM 記憶體、觸控驅動 IC、車用微處理器、CIS 影像感測器等產品。對於解析度、精細度及效能有較高的要求,需要使用 ArF 光阻來滿足其製造需求。根據 TECHCET 的資料,ArF 光阻的市場規模相對較大。新應材目前在 ArF 光阻的研發上較少著墨,但有能力生產 ArF 光阻問邊材料。

投資建議:基於(1)新應材在先進微影製程材料的產業地位,並且受惠於半導體大廠 2 奈米量產,預期 2026 年大幅成長,(2)台灣特用化學類股中,半導體占比最高,具備想像空間。(3)預估 2025 年 EPS 11.26 元,2026 年成長加速創高。

12/27/2024~12/31/2024 為新應材初次上市競拍期間,公開競拍底價為 410.26元,承銷價格為 480.00元。參考台灣營運內容相近同業的評價並考量新應材的獲利穩定度,建議競拍價格區間為 450~510元。(2025年 PER40~45X)



2024年12月30日

【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間≥35%
買進(Buy)	15%≤首次評等潛在上漲空間<35%
區間操作(Trading Buy)	5%≤首次評等潛在上漲空間<15%
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整
	建議降低持股

【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時,其前一日收盤價相較 3 個 月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級,定義如 上。爾後的投資評等係依循「首次評等」,直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於, 首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評 等,就是責任的開始,爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基 本面及股價變化,直到停止推薦。

停止推薦情境:

- 1. 達目標價。
- 2. 雖未達原訂目標價,但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息, 研判股價上漲空間已然有限,將適時出具降評報告。
- 3. 推薦後股價不漲反跌,亦將出具降評報告。

6

【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。 我們並不確保此資訊的完整性與正確性,投資人應了解,報告中有關未來 預測之陳述可能不會實現,因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投 資目的或依預定對 象之財務狀況所撰寫出來的,因此,此研究報告的目的, 既 非 對 投 資 人 於 買 賣 證 券 、 選 擇 權 、 期 貨 或 其 他 證 券 相 關 之 衍 生 性 商 品 提 供詢價服務,亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值 及收益,可能會有無預警地上升或下降,產生投資回報金額可能比原始投 資來得少的情形。